

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成27年1月8日(2015.1.8)

【公開番号】特開2013-167669(P2013-167669A)

【公開日】平成25年8月29日(2013.8.29)

【年通号数】公開・登録公報2013-046

【出願番号】特願2012-29228(P2012-29228)

【国際特許分類】

G 03 F	7/11	(2006.01)
C 08 G	77/04	(2006.01)
G 03 F	7/038	(2006.01)
G 03 F	7/039	(2006.01)
H 01 L	21/027	(2006.01)
C 08 G	77/14	(2006.01)

【F I】

G 03 F	7/11	5 0 3
C 08 G	77/04	
G 03 F	7/038	6 0 1
G 03 F	7/039	6 0 1
H 01 L	21/30	5 7 3
C 08 G	77/14	

【手続補正書】

【提出日】平成26年11月17日(2014.11.17)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 1 8 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 1 8 1】

【実施例、比較例】

上記合成例で得られたケイ素含有表面改質剤(1-1)～(1-31)、ポリマー成分としてのポリシロキサン化合物(2-1)～(2-8)、酸、熱架橋促進剤、溶剤、添加剤を表4-1～表4-3に示す割合で混合し、0.1 μmのフッ素樹脂製のフィルターで濾過することによって、ケイ素含有レジスト下層膜形成用組成物溶液をそれぞれ調製し、それぞれS o l . 1 ~ 5 2とした。